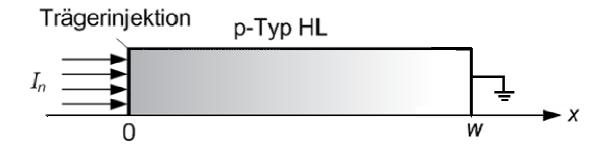
# Musterlösung zu Übungsblatt 7

## Aufgabe 1) Diffusionskapazität

Gegeben ist ein Siliziumstab der Länge w und Stirnfläche  $A=10\,\mu\text{m}^2$  bei Raumtemperatur T=300~K. Er ist p-dotiert mit einer Dichte von  $n_A=1\cdot10^{17}~\text{cm}^{-3}$ , die Eigenleitungsdichte beträgt  $n_i=1.5\cdot10^{10}~\text{cm}^{-3}$  und die relative Permittivität ist  $\varepsilon_{\rm r}=12$ . An der Stelle x=0 werden von links Minoritätsträger injiziert, so dass am Rand des Stabes eine Elektronen-Überschussträgerdichte  $n'_p(0)=1\cdot10^{15}~\text{cm}^{-3}$  entsteht. Auf der gegenüberliegenden Seite bei x=w ist der Stab geerdet, so dass dort Löcher nachfließen können, welche die Ladung der Elektronen kompensieren. Es gilt Störstellenerschöpfung, die Minoritätsträgerlebensdauer ist  $\tau=10~\text{ns}$  und die Diffusionskonstante beträgt  $D_n=23~\text{cm}^2\text{s}^{-1}$ .



a) Berechnen und skizzieren Sie den räumlichen Verlauf der Überschussminoritätsträgerdichte  $n'_p(x)$  für ein Bauteil der Länge  $w = 50 \,\mu\text{m}$ . Prüfen Sie zunächst, ob eine lange oder kurze Diffusionszone vorliegt.

### Lösung:

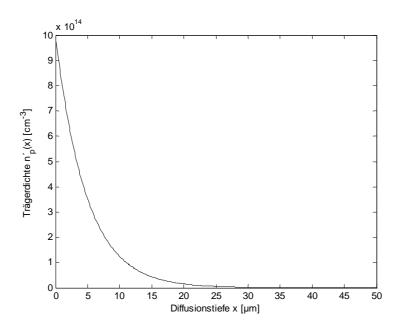
Ein Vergleich der Bauteillänge mit der Diffusionslänge  $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$  gibt an, ob es sich um eine kurze oder eine lange Diffusionszone handelt.

 $L_n = 4.8 \ \mu \text{m} \ll 50 \ \mu \text{m} = w$ , damit handelt es sich um eine lange Diffusionszone.

In dieser langen Diffusionszone fällt die Überschussminoritätsträgerdichte exponentiell ab entsprechend

$$n'_{p}(x) = n'_{p}(0) \exp\left(-\frac{x}{L_{n}}\right).$$

WS 2014/2015 Ausgabe am: 23.11.2015



b) Berechnen Sie die Debye-Länge im Halbleiter und beschreiben Sie den räumlichen Verlauf der Überschussmajoritätsträgerdichte  $p'_{p}(x)$ . Begründen Sie Ihr Vorgehen.

Lösung:

Die Debye-Länge beträgt 
$$L_{D,p} = \sqrt{D_p \tau_R}$$
, mit  $\tau_R = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\sigma_p}$ ,  $\sigma_p = ep \mu_p$ ,  $D_p = \frac{kT}{e} \mu_p$  ergibt sich

$$L_{D,p} = \sqrt{\frac{kT}{e^2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{n_A}} = 13,1 \,\text{nm}$$

Ab einer Länge der Größenordnung der Debeye-Länge werden die injizierten Überschussträger aufgrund der dielektrischen Relaxation abgeschirmt. Da die Debeye-Länge deutlich kleiner ist als die Diffusionslänge herrscht Quasi-Neutralität. In Näherung kann angenommen werden, dass sich eine Überschussmajoritätsträgerverteilung identisch zur Überschussminoritätsträgerverteilung ergibt,  $p_p'(x) = n_p'(x)$ .

c) Aufgrund der injizierten Minoritätsträger liegt kein thermisches Gleichgewicht vor und die Verteilung der Elektronen und Löcher muss nun durch Quasi-Ferminiveaus beschrieben werden. Berechnen Sie den energetischen Abstand eU der Quasi-Ferminiveaus an der Stelle x=0, wobei U die mit der Trägerinjektion verknüpfte äquivalente Spannung bezeichnet. Bei einem pn-Übergang entspricht die äquivalente Spannung gerade der an den Übergang angelegten technischen Spannung.

#### Lösung:

Ein Quasi-Ferminiveauabstand von -eU entspricht der Minoritätsträgerverteilung von  $n=n_{p,\text{th}}\exp\left(U/U_T\right)$  .

Damit ergibt sich eine äquivalente Spannung von  $U=U_T\ln\left(n/n_{p,th}\right)$ , wobei  $n=n_{p,th}+n_p'$  ist. Mit  $n_{th}=n_i^2/p_{th}=n_i^2/n_A$  ergibt sich

WS 2014/2015 Ausgabe am: 23.11.2015

$$U=U_T \ln \left(\frac{n_i^2/N_A+n_p'\left(0\right)}{n_i^2/n_A}\right)=0,69 \text{ V, bzw. ein Quasi-Ferminive auabstand von}$$
 
$$W_{Fn}-W_{Fp}=0,69 \text{ eV}.$$

d) Berechnen Sie den Verlauf der Elektronenstromdichte  $J_n(x)$ .

### Lösung:

Grundsätzlich gilt für die Diffusionsstromdichte der Elektronen

$$J_n(x) = eD_n \nabla n \Longrightarrow eD_n \frac{dn}{dx} .$$

Mit dem Verlauf der Überschusskonzentration ergibt sich:

$$\frac{dn}{dx} = -\frac{n_p'(0)}{L_n} \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right)$$

$$J_n(x) = -\frac{eD_n n_p'(0)}{L_n} \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right)$$

e) Berechnen Sie die spannungsabhängige Ladung Q(U), die in der Diffusionszone in Form von Überschussminoritätsträgern gespeichert ist. Betrachten Sie einen festen Arbeitspunkt  $U=U_0$  der äquivalenten Spannung und berechnen Sie die Änderung  $\Delta Q$  der in der Diffusionszone gespeicherten Ladung für kleine Spannungsänderungen  $\Delta U$ . Linearisieren Sie dazu die Beziehung Q(U) im Arbeitspunkt  $U_0$ . Vergleichen Sie den Quotienten  $\frac{\Delta Q}{\Delta U}$  nun mit der im externen Stromkreis wirksamen Diffusionskapazität  $C_D$ , wie sie in den Vorlesungsfolien beschrieben ist. Wie ist es zu erklären, dass der aus der internen Ladungsänderung hergeleitete Ladungs-Spannungs-Quotient doppelt so groß ist wie die Diffusionskapazität  $C_D$ , die sich auf den externen Ladungsfluss bezieht?

### Lösung:

Die gespeicherte Ladung ist durch die Integration der Überschussträgerdichte der Minoritäten über das Bauteil gegeben.

$$Q = -eA \int_0^w n_p'(x) dx$$

Im Fall der langen Diffusionszone

$$Q = -eA \int_0^w n_p'(x) dx$$

$$= -eA \int_0^w n_p'(0) \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) dx$$

$$= eAn_p'(0) \left[ L_n \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) \right]_0^w$$

$$= eAn_p'(0) L_n \left[ \exp\left(-\frac{w}{L_n}\right) - 1 \right]$$

WS 2014/2015

Ausgabe am: 23.11.2015

Wobei das Bauteil deutlich länger als die Diffusionslänge ist,  $w \gg L_n$  und damit  $Q = -eAL_n n'_n(0)$ .

Die Überschussminoritätsträgerdichte hängt von der angelegten Spannung ab, entsprechend

$$n_p'(0) = n_p(0) - n_{p,th}$$

$$= n_{p,th} \exp(U/U_T) - n_{p,th}$$

Damit gilt für die Ladung

$$Q = eAL_n \left( n_{p,th} - n_{p,th} \exp\left( U / U_T \right) \right).$$

In linearisierter Betrachtung um den Arbeitspunkt  $U_0$  ergibt sich

$$\left. \frac{\Delta Q}{\Delta U} \right|_{U=U_0} = -\frac{eAL_n n_{p,th}}{U_T} \exp\left(\frac{U_0}{U_T}\right).$$

Die Diffusionskapazität  $\mathcal{C}_{D}$  auf den Vorlesungsfolien ist gegeben als

$$\begin{split} C_D &= \frac{1}{2} G_0 \tau_n, \quad \text{wobei} \quad G_0 = \frac{I_{Sn}}{U_T} \exp\left(\frac{U_0}{U_T}\right), \quad I_{Sn} = \frac{AeD_n n_{p,th}}{L_n}, \quad L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \\ C_D &= \frac{1}{2} \frac{I_{Sn}}{U_T} \exp\left(\frac{U_0}{U_T}\right) \tau_n \\ &= \frac{1}{2} \frac{AeD_n n_{p,th} \tau_n}{L_n U_T} \exp\left(\frac{U_0}{U_T}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{AeL_n n_{p,th}}{U_T} \exp\left(\frac{U_0}{U_T}\right) \end{split}$$

Die errechnete Ladungs-Spannungs-Quotient ist demnach doppelt so groß, wie die tatsächliche Kapazität. Die Hälfte der Ladungsträger verschwindet im Bauteil durch Rekombination.

# Aufgabe 2) pn-Übergang

Gegeben ist eine pn-Diode, deren p-Seite mit einer Akzeptorendichte von  $n_A=11\cdot 10^{16}\,\mathrm{cm^{-3}}$  und deren n-Seite mit einer Donatorendichte von  $n_D=6\cdot 10^{16}\,\mathrm{cm^{-3}}$  dotiert sind. Das gesamte Bauteil ist aus Silizium ( $n_i=1,5\cdot 10^{10}\,\mathrm{cm^{-3}}$ ,  $\varepsilon_r=12$ ) gefertigt und wird bei Raumtemperatur ( $T=300\mathrm{K}$ ) betrieben. Es gelten Störstellenerschöpfung und Schottky-Näherung.

a) Berechnen Sie die Diffusionsspannung  $U_D$ , die sich zwischen p- und n-Gebiet einstellt.

### Lösung:

Geg.: 
$$n_A = 11 \cdot 10^{16} \, \text{cm}^{-3}$$
,  $n_D = 6 \cdot 10^{16} \, \text{cm}^{-3}$ ,  $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \, \text{cm}^{-3}$ 

Ges.: II

Die Diffusionsspannung kann aus den Dotierungen berechnet werden:

$$U_{D} = U_{T} \ln \left( \frac{n_{A} n_{D}}{n_{i}^{2}} \right) = 0.8 \,\mathrm{V}$$

b) Skizzieren Sie den Verlauf der Raumladungsdichte  $\rho(x)$  unter der Annahme der Schottky-Näherung. Berechnen Sie den Verlauf des elektrischen Feldes E(x), wobei Sie für die Ausdehnungen der Raumladungszone (RLZ) in das p- und n-Gebiet zunächst die unbekannten Größen  $l_p$  und  $l_n$  annehmen. Berechnen Sie aus der elektrischen Feldstärke das Potential  $\varphi(x)$ . Gehen Sie davon aus, dass der Potentialnullpunkt bei  $x=-l_p$  liegt und dass dort auch das elektrische Feld verschwindet. Beachten Sie, dass sowohl das elektrische Feld als auch das Potential bei x=0 stetig sein müssen.

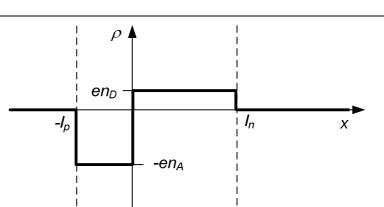
Lösung

Ges.: Skizze für  $\rho(x)$ , E(x),  $\varphi(x)$ 

1) Raumladungsdichten  $\rho(x)$ :

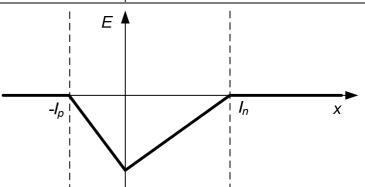
$$\rho(x) = e \Big[ n_{\scriptscriptstyle D} - n(x) - n_{\scriptscriptstyle A} + p(x) \Big]$$
 mit der Schottky Näherung 
$$n(x) = p(x) = 0 \ \text{folgt}$$

$$\rho(x) = \begin{cases} -en_{A} & -l_{p} < x < 0 \\ en_{D} & \text{für} & 0 < x < l_{n} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



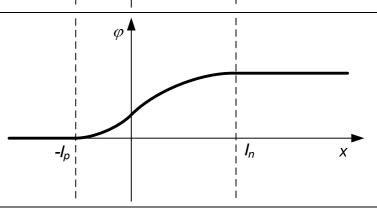
2) Feldstärke *E*(x):

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho \quad \rightarrow \quad \frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \rho$$
bzw.  $\varepsilon E = \int \rho \, dx$ 



3) Potential  $\varphi(x)$ : Der Verlauf folgt mit

$$\vec{E}=-\mathrm{grad}\, \varphi \ o \ rac{d \varphi}{d x}=-E$$
bzw.  $\varphi=-\int E\, d x$ 



c) Die Potentialdifferenz zwischen p- und n-Gebiet muss gerade  $U_{\scriptscriptstyle D}$  betragen. Berechnen Sie daraus die Gesamtlänge l der Raumladungszone und ihre jeweilige Ausdehnung in die n- und p-Halbleiter.

### Lösung:

Ges.: 
$$l$$
,  $l$  <sub>$n$</sub> ,  $l$  <sub>$p$</sub> 

$$l = \sqrt{rac{2arepsilon_{_{I}}arepsilon_{_{D}}}{e}}U_{_{D}}igg(rac{1}{n_{_{A}}}+rac{1}{n_{_{D}}}igg)}, \quad l_{_{p}} = rac{n_{_{D}}}{n_{_{A}}+n_{_{D}}}l, \quad l_{_{n}} = rac{n_{_{A}}}{n_{_{A}}+n_{_{D}}}l$$

$$\rightarrow$$
 *l* = 165.4 nm,  $l_p$  = 58.4 nm,  $l_n$  = 107.0 nm

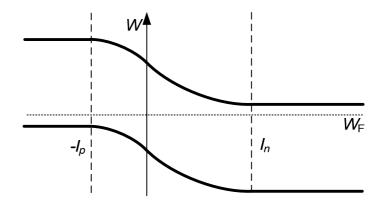
d) Skizzieren Sie das Banddiagramm für den Fall des thermischen Gleichgewichts. Dieses sollte die Fermi-Energie  $W_F$  und den Verlauf der Bandkanten  $W_{LV}(x)$  enthalten.

### Lösung:

Ges.: Banddiagramm W(x)

Banddiagramm 
$$W(x)$$
:

$$W_i(x) = W_i(-\infty) - e\varphi(x)$$



e) Die Diode wird nun mit einer Spannung von U=-5V betrieben (Sperrrichtung). Wie groß ist die RLZ jetzt? Skizzieren Sie das Banddiagramm im Sperr-Betrieb und beschreiben Sie den Unterschied zu Ihrer Zeichnung aus d). Zeichnen Sie die Quasi-Fermi-Niveaus  $W_{Fn}$  und  $W_{Fp}$  sowie die äußere Spannung U ein.

### Lösung:

Geg.: U = -5V

Ges.: 1

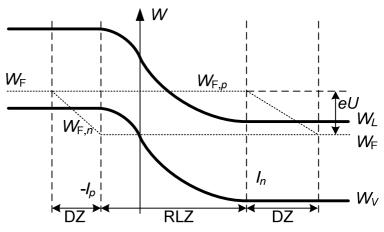
$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}{e}(U_{\rm D} - U) \times \left(\frac{1}{n_{\rm A}} + \frac{1}{n_{\rm D}}\right)} \quad \rightarrow \quad l = 445\,\rm nm$$

WS 2014/2015 Ausgabe am: 23.11.2015

Die Sperrspannung verbiegt die Bänder noch weiter. Der Abstand zwischen dem Fermi-Niveau im pund n-Bereich entspricht der Energie *eU*.

Die Verteilung von Ladungsträgern in der Raumladungszone und den Diffusionszonen kann mit Hilfe von Quasi-Fermi-Niveaus beschrieben werden. Im Sperrbetrieb läuft  $W_{F,p}$  oben, d.h. es findet über einen größeren Raumbereich eine Verarmung von Ladungsträgern

statt, da 
$$p \propto \exp \left(-rac{W_{F,p}-W_{V}}{k_{_{B}}T}
ight)$$
 gilt.



**ACHTUNG:** 

Zeichnung nicht maßstäblich. Die Diffusionszonen (DZ) sind wesentlich länger als die Raumladungszone (RLZ).

f) Die Diode wird mit einer Spannung U=+0,6V betrieben (Flussrichtung). Wie groß ist die RLZ jetzt? Skizzieren Sie wiederum das Banddiagramm. Beschreiben Sie den Unterschied zu Ihrer Zeichnung aus d). Zeichnen Sie die Quasi-Fermi-Niveaus  $W_{Fn}$  und  $W_{Fp}$  sowie die äußere Spannung U ein.

### Lösung:

Geg.: U = +0.6 V

Ges.: *l*, Banddiagramm

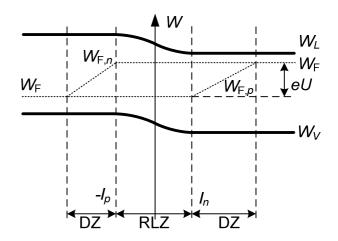
Die Spannung in Flussrichtung wirkt der

Bandverbiegung durch die

Diffusionsspannung  $U_D$  entgegen. Der Abstand zwischen dem Fermi-Niveau im pund n-Bereich entspricht auch hier der Energie eU.

Wird die Diode in Vorwärtsrichtung betrieben, läuft  $W_{F,p}$  unten, d.h. die Besetzungswahrscheinlichkeit für Löcher in der Raumladungszone ist höher, da auch

hier 
$$p \propto \exp \left(-rac{W_{F,p}-W_{V}}{k_{_{B}}T}
ight)$$
 gilt.



ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich! Die Diffusionszonen (DZ) sind wesentlich länger als die Raumladungszone (RLZ)!

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}{e}(U_{\rm D} - U) \times \left(\frac{1}{n_{\rm A}} + \frac{1}{n_{\rm D}}\right)} \quad \rightarrow \quad l = 82.7 \,\rm nm$$